BL-6A,10C/2022G555

X線散乱法による多環状高分子および多環状高分子/線状高分子混合系の 構造解析

Structural Analysis of Multicyclic Polymer and Multicyclic Polymer/Linear Polymer Blend System by X-ray Scattering

磯野拓也 1,*

¹北海道大学大学院工学研究院応用化学部門 〒060-8628 北海道札幌市北区北 13 条西 8 丁目 Takuya ISONO^{1,*} ion of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Hokkaido Un

¹Division of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Hokkaido University N13W8, Kita-Ku, Sapporo 060-8628, Japan

1 <u>はじめに</u>

ロタキサン構造を架橋点として導入したネットワ ークポリマーは、架橋点が自由に移動できるため応 力の効率的な分散を可能にし、超弾性などの興味深 い物性を発現する。こうしたロタキサン架橋の導入 による高分子材料の強靭化は実用化に向けて近年広 く検討が進められている。しかし、ロタキサン形成 の原理上、既存のロタキサン架橋では「シクロデキ ストリン (CD) +ポリエチレングリコール (PEG)」の ような強い分子間相互作用の働く環状/線状成分の 組み合わせに限定される。そのため、特定の組合わ せに限定されないロタキサン架橋構築法の確立に興 味がもたれる。こうした背景から、我々は分子間相 互作用を必要とせずにロタキサン架橋を構築する新 規方法論として、環状高分子と線状高分子の混合系 に着目した。同種ポリマーの環状鎖と線状鎖を混合 すると、線状鎖が環状鎖を貫通し「擬ロタキサン」 を形成することがレオロジー測定やシミュレーショ ンによって明らかにされている[1]。また、我々らの 最近の研究において、実験およびシミュレーション から複数の環状ユニットから構成される多環状高分 子が単環状高分子よりも効率的にロタキサンを構築 できることを見出している[2]。この特異な性質は、 引力的な相互作用を必要とせずにロタキサン架橋を 可能にするものであり、ゴム・エラストマーの強靭 化などに応用できるものと期待される。

 最近、我々はポリスチレン(PS)からなる多環状 高分子を熱可塑性エラストマー (polystyrene-bpoly(ethylene-co-propylene)-b-polystyrene; SEPS) に添 加することで材料の破断伸びが向上する興味深い結 果を得た。その原因の一端を探るべく、本研究では 小角 X線散乱(SAXS)測定により多環状 PS 混合によ る SEPS のミクロ相分離構造変化を検討した。

2 実験

SEPS (A または B; 0.80 g) と 多環状 PS (4*c*-PS_{12k}; $M_{n,MALS} = 54,400$ g mol⁻¹; average number of cyclic unit =

4.4; $M_{n,NMR}$ of cyclic unit = 12,300 g mol⁻¹; 40 mg) をキ シレン (25 mL) に溶解させ、直径 10.5 cm のテフロン シャーレに静かに流し込んだ。圧縮空気気流下、 40 °C で 24 時間溶媒を留去した後、50 °C で 24 時間 真空乾燥することで目的の SEPS ブレンドフィルム を得た。その後、減圧下 120 ℃ で、3 日間熱アニー リング処理を施し、SAXS 測定に用いた。また、比 較用サンプルとして上記と同様の方法を用いて SEPS (0.80 g) のみをキシレン (25 mL) に溶解させて 調製した SEPS フィルムならびに、SEPS (0.80 g) に 加えて 直鎖状 (*l*-PS; *M*_{n,MALS} = 54,800 g mol⁻¹) (40 mg)、 グラフト PS (g-PS; $M_{n,MALS} = 55,000$ g mol⁻¹; average number of side chain = 8.3; $M_{n,NMR}$ of side chain = 6,100 g mol⁻¹) (40 mg) および 単環状 PS (*lc*-PS_{12k}; *M*_{n,MALS} = 11,500 g mol⁻¹) (40 mg) をそれぞれキシレン (25 mL) に 溶解させて調製した SEPS ブレンドフィルムを得た。

SAXS 測定は BL-6A または 10C にて、広角散乱 (WAXS) 用検出器込みでカメラ長 1.5 m または 2.5 m のセットアップにて行った。測定試料はサンプルホ ルダーにテープにより固定した。露光時間は 60 sec とした。SAnglerによって2次元散乱プロファイルを 円環平均することで1次元プロファイルを得た。散 乱ベクトル q はベヘン酸銀の回折ピークをもとに校 正した。

3 結果および考察

異なるトポロジーを有するポリスチレン (図 1) が 添加された SEPS フィルムに熱アニーリングを施し、 SAXS 測定を行った。いずれの場合でもポリスチレ ン添加量は SEPS に対して 5 wt% とした。また、本 研究では分子量およびスチレン含有量が異なる 2 種 類の SEPS を用意した (SEPS A: $M_{n,SEC} = 56,200 \text{ g mol}^{-1}$; PS content = 18wt%; SEPS B: $M_{n,SEC} = 213,000 \text{ g mol}^{-1}$; PS content = 20wt%)。



図1:トポロジーの異なる各種 PS の分子構造

SEPS A および SEPS に *mc*-PS_{12k} をブレンドしたサ ンプルに対して SAXS 測定を行った結果を 図 2 に示 す。いずれの SAXS プロファイルも 1 次散乱ピーク (*q**) とその $\sqrt{3}$ 倍の位置に散乱ピークを与えたことか らへキサゴナルシリンダー (HEX) 状のミクロ相分離 構造を形成していることが明らかになった。*q** のピ ーク位置から計算されたシリンダー間距離 (*d*_{C-C} = (2 π/q^*)(4/3)^{1/2}) を比較すると、*4c*-PS_{12k} が添加された SEPS の *d*_{C-C} は 29.9 nm となり、SEPS 単体の *d*_{C-C} (30.5 nm) と同等の値であることが判明した。このこ とより、*4c*-PS_{12k} は SEPS の PS ドメインに取り込ま れず、マクロに相分離していることが判明した。こ れは、フィルム調製に使用した *4c*-PS の分子量が SEPS の PS 分子量よりも明らかに大きかったことに 起因する。



図 2 : (a) SEPS A と (b) 4*c*-PS_{12k}を 5wt%添加したブレ ンドの SAXS プロファイル。

続いて、より分子量の大きい SEPS B に対して 様々なトポロジーを有する PS を 5wt%添加し、 SAXS 測定を行った。その結果、いずれの SAXS プ ロファイルも q^* とその $\sqrt{3}$ 倍の位置に散乱ピークを 与えたことから HEX 状のミクロ相分離構造を形成 していることが明らかになった (図 3)。 q^* のピーク 位置から計算された d_{C-C} を比較すると、各 PS が添 加された SEPS の d_{C-C} は 52.6 – 56.1 nm となり、SEPS B 単独よりも 6 – 10 nm 程度増加した。これらの結果 より、各ポリスチレンは SEPS のポリスチレンドメ インに取り込まれていることが強く示唆された。一 方で、添加する PS のトポロジーによって d_{C-C} が異 なることも明らかになった。例えば、4c-PS_{12k} と同 等の分子量を有する *I*-PS を添加した場合を比較する と、4c-PS_{12k}添加のほうが d_{C-C} の増加分は明らかに大 きい。また、環状ユニットサイズが同等となる *lc*-PS_{12k}と *4c*-PS_{12k}で比較しても、*4c*-PS_{12k}添加の*dc*-c増加分は明らかに大きい。そのため、分子量以外のパラメータ、すなわち高分子鎖のトポロジーの関与が考えられる。



図 3: (a) SEPS B、 (b) *l*-PS、(c) *g*-PS、(d) *lc*-PS_{12k}、 (e) *4c*-PS_{12k}を 5wt%添加したブレンドの SAXS プロフ アイル。

4 <u>まとめ</u>

添加する PS のトポロジーによって SEPS ブレンド のミクロ相分離挙動が異なってくることが明らかに なった。今後、SAXS のパラクリスタル解析ととも に透過型電子顕微鏡観察を組み合わせながら、環状 混合熱可塑性エラストマーの構造解析を進めたい。

参考文献

- [1] M. Kapnistos, et al. *Nat. Mater.* 7, 997 (2008); V. G. Tsalikis, et al. *ACS Macro Lett.* 3, 763 (2014) など.
- [2] K. Hagita, et al. *Polymer* 245, 124683 (2022); M. Ebe, et al. *Angew. Chem. Int. Ed.* 62, e202304493 (2023) など.

*isono.t@eng.hokudai.ac.jp